



大阪府立産業技術総合研究所技術講習会



センシング技術応用研究会テクニカルスクール

## MEMS 技術とフォトリソグラフィの基礎と応用 ～レーザ描画装置の紹介～

研究所では、設置した試験研究機器を用いて中小企業の皆様の新技术・新製品の開発や生産管理・品質管理のお手伝いをしております。これら試験研究機器の関連技術、利用範囲、性能などの特徴をより具体的に皆様方にご理解いただくため、下記内容で講習を行いますのでご案内申し上げます。多数のご参加をお待ちいたしております。

- 日 時 : 平成23年7月29日(金) 13:20 ~ 17:00
- 場 所 : 大阪府立産業技術総合研究所 本館 2階 「第1研修室」  
和泉市あゆみ野2-7-1 (裏面図参照)
- 主 催 : 大阪府立産業技術総合研究所、センシング技術応用研究会
- 定 員 : 30名  
(受講票は発行いたしません。定員を超えたときは、お断りする方のみご連絡します。)
- 参加費 : 無 料
- 申込先 : センシング技術応用研究会までFAXまたはメールにてお申込みください。  
和泉市あゆみ野2丁目7番1号 大阪府立産業技術総合研究所内  
電話 : 0725-51-2534 FAX : 0725-51-2597  
メール : sstj@tri.pref.osaka.jp
- 講習内容
  - ・「MEMS技術とフォトリソグラフィ」13:20~14:00  
大阪府立産業技術総合研究所 情報電子部長 井上幸二  
携帯電話用マイクロフォンやプロジェクター用DMDなど、MEMS技術で作られたデバイスが身近になってきた。それに伴い、MEMS技術を用いたデバイス開発が活発になっている。ここでは、MEMS技術の中でも最も重要である微細加工技術(フォトリソグラフィ)について解説する。
  - ・「フォトマスク設計の注意点とMEMSセンサの作図例」14:00~14:30  
大阪府立産業技術総合研究所 主任研究員 田中恒久  
フォトマスク設計初心者を対象にしてフォトマスク設計に必要な基本知識について説明する。本研究所にて開発したMEMS超音波センサのフォトマスク作図例について紹介する。
  - ・「レーザ描画装置について」14:40~15:20  
大阪府立産業技術総合研究所 主任研究員 村上修一  
He-Cdレーザを搭載したレーザ直接描画装置(ハイデルベルグインストルメンツ社)を(株)日本レーザーより導入した。これによりフォトマスク作製のみならず、フォトレジストを塗布した基板へのマスクレス露光(直接描画)が可能である。講演では、本装置の仕様、利用方法について述べる。

—見学—

「大阪府立産業技術総合研究所 MEMS・薄膜作製関連研究室」15:30~17:00

